

# Modellbasierte Temperaturregelung

Auf Lam Reinigungs- und Ätzanlagen werden flüssige Chemikalien auf einen rotierenden Wafer aufgebracht. Mit Hilfe eines Heizmoduls kann der Wafer, bzw. das Medium am Wafer erhitzt werden.

- Entwicklung eines mathematischen Modells zur Beschreibung des Temperaturverlaufs am Wafer.
- Validierung des Modells Anhand von Messdaten
- Entwurf eines modellbasierten Temperaturreglers
- Beginn: ab sofort
- Kontakt: Martin Horn, Stefan Koch

